

中華民國專利證書

新型第 M 361039 號

新型名稱：雙折射共光程光學裝置

專利權人：亞東技術學院

創作人：張堯盛

專利權期間：自2009年7月11日至2018年12月29日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權依法應提示新型專利技術報告進行警告

經濟部智慧財產局

局長 王美花

中華民國

98



月 11 日

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿之次日起消滅。

【19】中華民國

【12】專利公報 (U)

【11】證書號數：M361039

【45】公告日：中華民國98(2009)年7月11日

【51】Int. Cl. : **G03F7/20 (2006.01)**

新型

全 5 頁

【54】名稱：雙折射共光程光學裝置

【21】申請案號：097223592

【22】申請日：中華民國97(2008)年12月30日

【72】創作人：張堯盛

【71】申請人：亞東技術學院 ORIENTAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
臺北縣板橋市四川路2段58號

【74】代理人：

1

2

【57】申請專利範圍：

1.一種雙折射共光程光學裝置，係可供以應用一干涉儀中，用以檢測奈米級以下之線位移量，其包括：
一雙折射晶體，可使一光源所產生的一光線投射後，可使垂直入射的該光線，在通過該雙折射晶體時，分成一尋常光線及一非尋常光線；
一光學平台，由一固定反射鏡及一奈米位移反射鏡所組成而成，該尋常光線係可通過固定反射鏡，該非

尋常光線則通過該奈米位移反射鏡。

- 2.如申請專利範圍第1項所述的雙折射共光程光學裝置，其中，該尋常光線為一參考光。
- 3.如申請專利範圍第1項所述的雙折射共光程光學裝置，其中，該非尋常光線為一感測光。
- 4.如申請專利範圍第1項所述的雙折射共光程光學裝置，其中，該光源係
- 5.
- 10.

(2)

3

由一雷射光源提供。

- 5.如申請專利範圍第4項所述的雙折射共光程光學裝置，其中，該光源與一光隔絕器相接。
- 6.如申請專利範圍第5項所述的雙折射共光程光學裝置，其中，該光隔絕器與一分光暨檢測裝置相接。
- 7.如申請專利範圍第6項所述的雙折射共光程光學裝置，其中，該分光暨檢測裝置由一第一分光鏡、一四分之一波片、一第二分光鏡、一第一偏極板、一第二偏極板、一第一偏極板、及一第二偏極板所組成而成。
- 8.如申請專利範圍第6項所述的雙折射共光程光學裝置，其中，該分光暨

4

檢測裝置連結至一合成外差訊號處理裝置。

- 9.如申請專利範圍第8項所述的雙折射共光程光學裝置，其中，該合成外差訊號處理裝置連結至一顯示裝置。

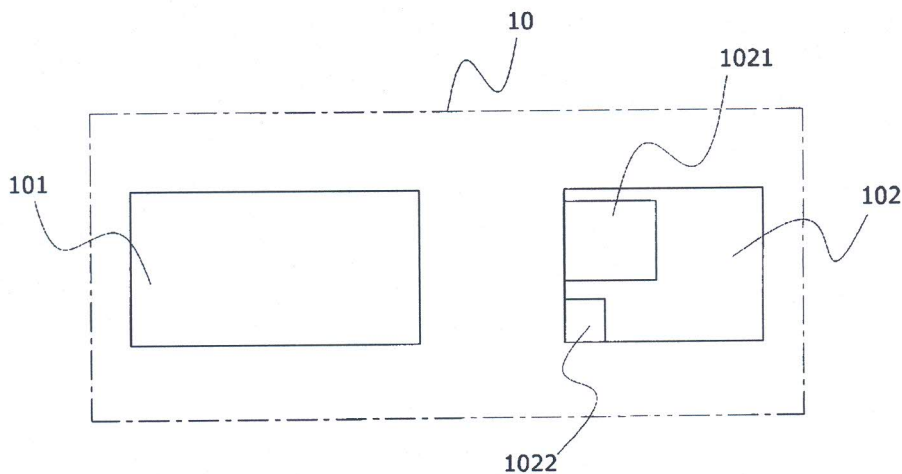
圖式簡單說明：

第1圖，為本創作的組成示意圖。

10. 第2圖，為本創作的實施示意圖(一)。

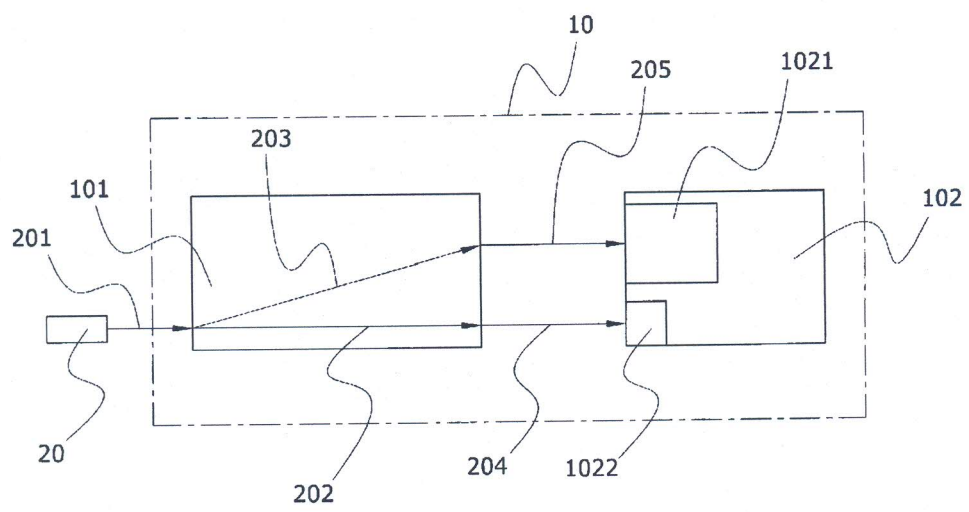
第3圖，為本創作的實施示意圖(二)。

15. 第4圖，為干涉儀的組成單元示意圖。



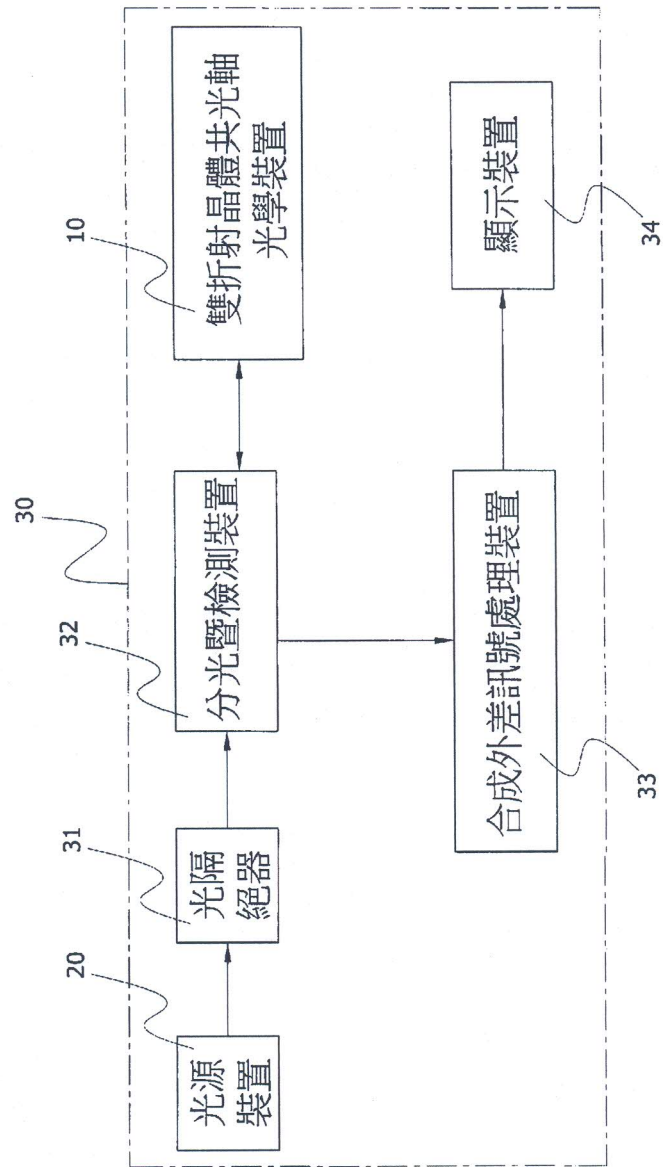
第1圖

(3)



第 2 圖

(4)



第 3 圖

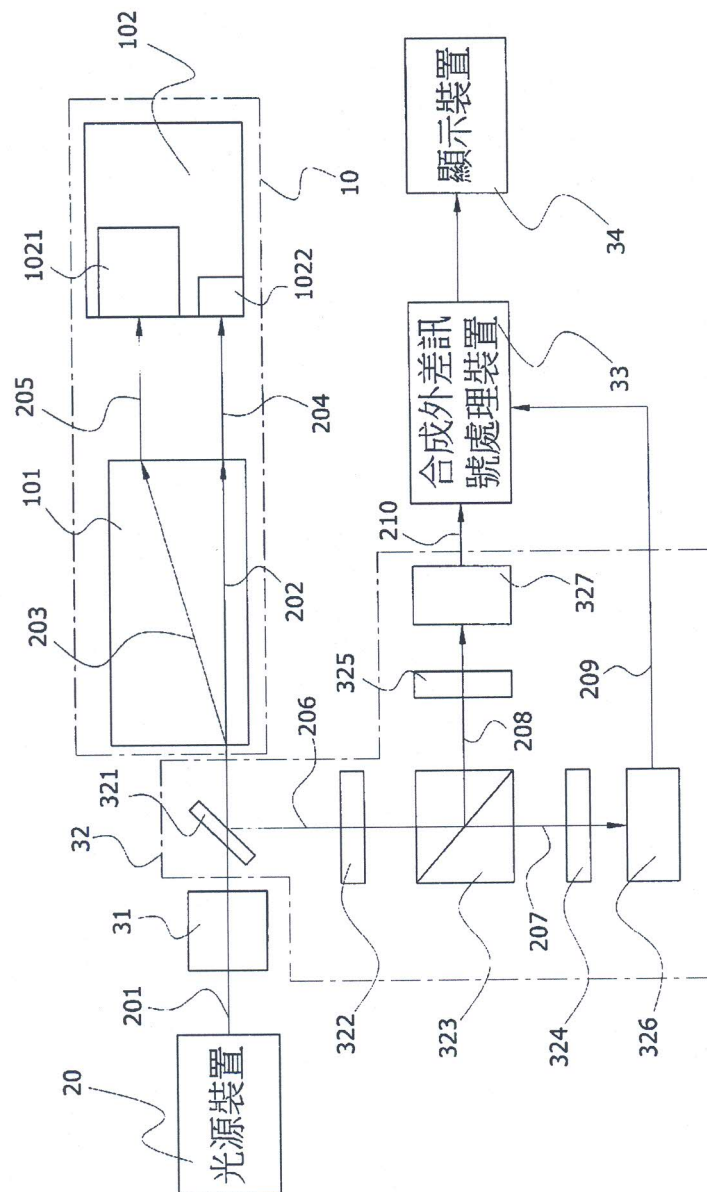


圖 4 第 4

經濟部智慧財產局 函

機關地址：台北市辛亥路2段185
號3樓

傳 真：(02)23779875

234 掛號

臺北縣永和市福和路353號11樓之18

受文者：亞東技術學院（代收人：黃
茂時 先生）

發文日期：中華民國98年7月11日發文

發文文號：(98)智專一(一)證字第

09871138340號

0987113834001

速 別：

密等及解密條件：

附件：專利證書1紙

主旨：發給第097223592號專利案新型第M361039號專利證書1紙
，自民國101年起，每年應於7月10日屆期前繼續繳納年費
，請 查照。

說明：依98年6月12日所繳證書費及第1至第3年年費辦理。（請注
意背面說明）

正本：亞東技術學院
（代收人：黃茂時 先生）

局長 王 美 花

依照分層負責規定
授權單位主管決行

裝

訂

線